



## Presentación de la Planta Piloto de Fabricación de Células Solares de la Empresa Siliken en la Universidad Politécnica de Valencia

Valencia, Ciudad Politécnica de la Innovación, 10 de julio de 2009

### Características técnicas de equipos disponibles en la Planta Piloto de Siliken en la UPV

Equipos disponibles:

El 85% de los equipos de la línea serán de diseño propio y tendrán rendimientos superiores a 100 obleas/hora con substratos desde unos pocos milímetros hasta 210mmx210mm. Los equipos se pueden clasificar en:

- a) Sistema de limpieza y patronado químico. Tratamientos de limpieza, transferencia de patrones, texturaciones.
- b) Hornos para difusión de hasta 1300C, Wet oxidation, POCl<sub>3</sub>, BBr<sub>3</sub>.
- c) Sistema de crecimiento de películas delgadas de Pulverización catódica (sputtering). Películas delgadas de materiales metálicos, semiconductores y aislantes. Capacidad de crecer hasta 6 capas de materiales distintos sin romper el vacío.
- d) Sistema de ataque con gases (RIE) con dos reactores. Ataque superficial en plasmas de CF<sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>, O<sub>2</sub>, CHF<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, HBr.
- e) Sistema de crecimiento de películas a partir de fase vapor y controlada por plasma. Plasma-enhanced Chemicals vapor deposition. Equipo con tres reactores independientes.
- f) Sistema de litografía en línea. Patrones sobre obleas de hasta 300mm, tamaños de línea hasta 500 nm y alineamientos por debajo de la micra.

*Universidad Politécnica de Valencia; Ciudad Politécnica de la Innovación; Camino de Vera s/n. Entrada por C/Ingeniero Fausto Elio – frente al No 28; Edificio 8E, Cubo Rojo; Tercera Planta.*

*Se ruega confirmación; plazas limitadas; info@circulocpi.es; 96 387 98 86 // Ext. 78284*